

СОСТОЯНИЯ Eu и Mn В ТЕЛЛУРИДЕ СВИНЦА

Громовой Ю. С., Дарчук С. Д., Коновалов В. Н., Лакеевков В. М.,
Пляцко С. В., Сизов Ф. Ф.

Исследованы электрические, оптические свойства и ЭПР монокристаллов $\text{PbTe} : \text{Eu} (\text{Mn})$ до и после воздействия ИК лазерного излучения в области прозрачности матрицы. Определены константы спин-гамилтоняна для ионов Eu^{2+} и Mn^{2+} . Для последних они соответствуют известным из литературы, а для ионов Eu^{2+} определены впервые: $g=1.9975 \pm 0.0005$, $b_4=43 \pm 0.5$ Э, $b_6=-0.68 \pm 0.57$ Э, $A=28 \pm 0.5$ Э (^{151}Eu), $A=12.7 \pm 0.5$ Э (^{153}Eu). Установлено, что в кристаллах PbTe с содержанием $0.02 \leq N_{\text{Eu}} \leq 0.2$ и $0.017 \leq N_{\text{Mn}} \leq 0.9$ вес% существуют скопления этих примесей, в результате влияния которых происходит уширение линий ЭПР, замыкание сверхтонкой структуры, возникновение потенциальных барьеров, проявляющихся в особенностях проводимости и фотоэдс. Использование ИК лазерного облучения позволяет значительно повысить степень совершенства изученных кристаллов.

Введение. Проблема примесных и дефектных состояний в соединениях $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ и наиболее изученном из них — теллуриде свинца является в настоящее время одной из наиболее важных с точки зрения возможности практического применения этих материалов [1].

Полупроводники $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ обладают низкой термодинамической стабильностью [2] и, как следствие, широкой по сравнению с другими полупроводниками областью гомогенности, причем вакансии металла и халькогена являются электроактивными. Введение примесей в них из-за более низких энтальпий образования «примесь—теллур» с большой вероятностью приводит к образованию фрагментов другой кристаллической структуры [3]. Кроме того, вследствие, например, концентрационного переохлаждения в них возникают обогащенные металлом и Te электронейтральные включения [4]. Поэтому следует ожидать существенного изменения свойств этих объектов под воздействием внешних факторов, разрушающих такие фрагменты или включения, что было показано, например, в [5] при облучении этих полупроводников ИК лазерным излучением в области прозрачности матрицы $\hbar\omega < E_g$, где E_g — ширина запрещенной зоны.

Для установления зарядового состояния примесных центров, их комплексообразования и наблюдения динамики изменения свойств полупроводников $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$ под действием внешних воздействий целесообразно использовать ЭПР активные примеси, что дает возможность применить такой метод изучения структуры центров, как ЭПР. В качестве таких ЭПР активных центров были выбраны довольно хорошо изученная в PbTe примесь Mn (см., например, [6]), находящаяся в состоянии Mn^{2+} , и примесь Eu, находящаяся предположительно в состоянии Eu^{2+} [7]. Изучены поведение этих примесей и изменение свойств PbTe при действии ИК лазерного излучения в области прозрачности матрицы.

1. Образцы и методы исследования

Монокристаллы $\text{PbTe} : \text{Eu}$ были выращены по методу Чохральского, содержание примеси в расплаве составляло $0.02 \div 0.2$ вес%. Кристаллы имели p -тип проводимости с концентрацией дырок при температуре жидкого азота $p_{77} \cong (2 \div 5) \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ независимо от концентрации примеси в расплаве. Плотность дислокаций в них $N_D \cong (2 \div 5) \cdot 10^5 \text{ см}^{-2}$.

Выращенные монокристаллы РbTe Eu можно было разделить на две группы в соответствии с электрофизическими свойствами. Так, для кристаллов первой группы с малой концентрацией Eu температурные зависимости коэффициента Холла $R_H(T)$ не отличались от подобных зависимостей для нелегированных монокристаллов p -РbTe, и подвижность носителей тока в этих образцах составляла $\mu_{77} \cong 10^4$ см²/В·с. Для монокристаллов с большим содержанием Eu было характерно значительное уменьшение подвижности свободных дырок в области гелиевых температур, а в зависимостях $R_H(T)$ наблюдались аномалии в области температур 4.2–100 К (рис. 1, кривая 1), предположительно связываемые с образованием комплексов с участием Eu и возникновением потенциальных барьеров на границе включения/матрица РbTe, подтверждением чего явились

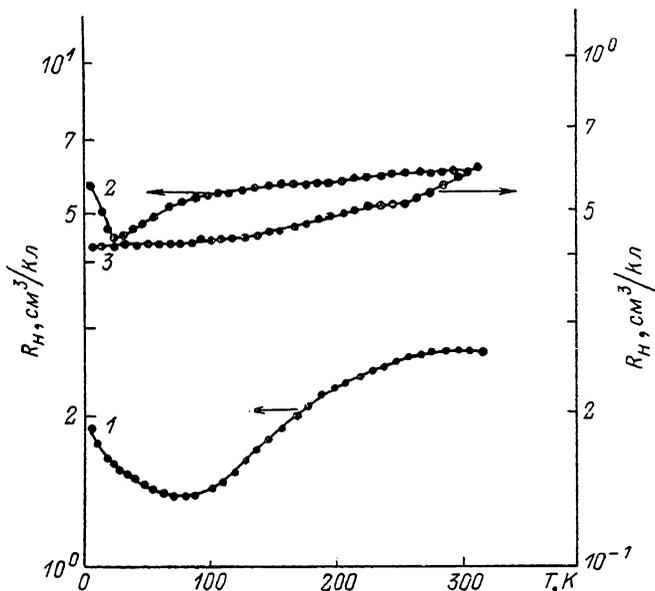


Рис. 1. Температурные зависимости коэффициента Холла в монокристаллическом образце РbTe : Eu ($N_{Eu} = 0.2$ вес%).

1 — до обработки ИК лазерным излучением, 2 — время облучения 4.5 ч (p-тип), 3 — время облучения 10 ч (n-тип). Плотность мощности лазерного излучения $W \cong 20$ Вт/см².

значительные сигналы фотоэдс в отсутствие смещения, регистрируемые на данных образцах при температуре ниже 100 К, и наличие потенциального рельефа при исследовании легированных кристаллов РbTe методом наведенного тока [3].

Затем образцы подвергались воздействию лазерного излучения ИК диапазона с энергией квантов $\hbar\omega = 0.118$ эВ, т. е. при выполнении условия $\hbar\omega < E_g$, где $E_g^{РbTe}$ (300 К) = 0.32 эВ — ширина запрещенной зоны РbTe.

После облучения лазером в кристаллах РbTe : Eu с концентрацией примеси 0.02 вес% наблюдалось уменьшение концентрации дырок вплоть до $p_{77} \cong \cong 10^{17}$ см⁻³, и скорость изменения концентрации во времени при фиксированной плотности мощности излучения не отличалась от скорости изменения концентрации носителей тока в нелегированном p -РbTe [8]. При дальнейшем увеличении дозы облучения наблюдалась инверсия типа проводимости РbTe : Eu.

В зависимостях $R_H(T)$ с большим содержанием Eu происходили существенные изменения: исходная зависимость (рис. 1, кривая 1) трансформировалась к виду, представленному кривой 2. Наблюдаемые изменения могут быть связаны с диссоциацией под действием лазерного излучения комплексов, обогащенных Eu. В исходных необлученных кристаллах в области температур 4.2–100 К за счет возникновения потенциальных барьеров изменяется механизм рассеяния свободных носителей по сравнению с нелегированными кристаллами, что ведет к появлению аномалии в зависимости $R_H(T)$. Под действием лазерного излучения, как это установлено и из исследований ЭПР, происходят распад

включений, содержащих Eu, и, как следствие, понижение величины потенциальных барьеров по сравнению с величиной kT . Поэтому особенности в зависимостях $R_H(T)$ проявляются при более низких температурах (кривая 2). После инверсии типа проводимости на электронный аномалии в $R_H(T)$ исчезают (кривая 3), подвижность носителей возрастает, что обусловлено исчезновением барьеров в связи с «рассасыванием» неоднородностей или их резким уменьшением при изменении типа проводимости матрицы.

Исследование спектральных зависимостей оптического поглощения с использованием спектрометра ИКС-31 показало, что с увеличением дозы облучения возрастает пропускание образцов PbTe : Eu от 1÷2 до 15÷20 %, что связано с уменьшением концентрации дырок и, как следствие, с уменьшением поглощения на свободных носителях. Вид спектральных зависимостей коэффициента поглощения на монокристаллах PbTe : Eu практически не отличается от таковых, полученных для стехиометрических образцов при той же концентрации свободных носителей. Ширина запрещенной зоны исследованных кристаллов PbTe : Eu с содержанием Eu ≤ 0.2 вес % не отличается от E_g в PbTe, хотя при больших содержаниях Eu увеличивается E_g значительно [9].

Аналогичные описанным выше аномалии проявляются в зависимостях $R(T)$ в монокристаллах p -PbTe, легированных марганцем, что также свидетельствует об образовании ассоциатов с участием примеси, приводящих к возникновению в кристалле макроскопического потенциального рельефа. Трансформация зависимостей $R(T)$ под действием лазерного излучения происходит таким же образом, как и в кристаллах PbTe : Eu. Основные электрические характеристики 6 из 28 исследованных монокристаллов PbTe : Eu (Mn), а также их изменение под действием лазерного излучения приведены в таблице.

Электрические характеристики монокристаллов PbTe : Eu (Mn)

№ образца	Легированная примесь	Содержание примеси, вес %	Тип проводимости		Концентрация носителей, см ⁻³		Подвижность носителей, см ² /В · с		Продолжительность облучения, ч
			до облучения	после облучения	до облучения	после облучения	до облучения	после облучения	
1	Mn	0.017	p	p	$8.28 \cdot 10^{18}$	$6.24 \cdot 10^{17}$	$4.99 \cdot 10^3$	$3.23 \cdot 10^3$	8
2		0.17	p	p	$1.32 \cdot 10^{18}$	$3.07 \cdot 10^{17}$	$5.64 \cdot 10^2$	$4.71 \cdot 10^1$	4
3		0.4	n	n	$2.14 \cdot 10^{17}$	$2.11 \cdot 10^{18}$	$3.93 \cdot 10^3$	$7.89 \cdot 10^3$	2
4	Eu	0.02	p	p	$4.82 \cdot 10^{18}$	$1.83 \cdot 10^{18}$	$3.03 \cdot 10^3$	$3.25 \cdot 10^3$	3
5		0.2	p	p	$4.09 \cdot 10^{18}$	$3.63 \cdot 10^{17}$	$3.12 \cdot 10^3$	$2.18 \cdot 10^3$	4.5
6		0.2	p	n	$4.09 \cdot 10^{18}$	$1.37 \cdot 10^{19}$	$3.12 \cdot 10^3$	$1.32 \cdot 10^3$	9

2. Электронный парамагнитный резонанс примесей Eu и Mn

Исследования электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) проводились на спектрометре VARIAN E-12 в области температур 4.2÷300 К.

2.1. PbTe : Eu. Спектры ЭПР исходных монокристаллических образцов PbTe : Eu при направлении магнитного поля вдоль $\langle 100 \rangle$ содержат 7 частично перекрывающихся линий (тонкая структура $S=7/2$), на фоне которых просматриваются линии сверхтонкой структуры (СТС) (рис. 2, а). Наличие 7 линий тонкой структуры свидетельствует о том, что Eu внедряется в решетку PbTe в двухвалентном состоянии.

Облучение образцов PbTe : Eu в течение нескольких часов ИК излучением CO₂-лазера ($\hbar\omega=0.118$ эВ) приводило к значительному увеличению (в ~20—30 раз) интенсивности линий СТС (рис. 2, б). Наибольшее разрешение СТС наблюдается на самой интенсивной центральной линии спектра, принадлежащей переходу $-1/2 \leftrightarrow +1/2$. На исходных и на необлученных образцах с концентрацией Eu 0.02 вес % спектры ЭПР не наблюдаются.

На облученных ИК излучением монокристаллических образцах с концентрацией примеси >0.02 вес % исследована угловая зависимость спектра ЭПР

при вращении магнитного поля в плоскости (100) (рис. 3). Цифры у кривых указывают типы переходов. При направлении магнитного поля вдоль $\langle 100 \rangle$ ($\theta=0$) линии тонкой структуры (ТС) максимально разнесены по полю. Угловая зависимость спектра ЭПР соответствует кубической симметрии центра.

RbTe обладает структурой типа NaCl, точечная симметрия узла O_h . Ионный радиус Eu^{2+} меньше ионного радиуса Rb^{2+} ($r_{\text{Rb}^{2+}}=1.26 \text{ \AA}$), так что можно не ожидать заметного искажения ближайшего окружения при замещении, что и подтверждается угловой зависимостью спектра.

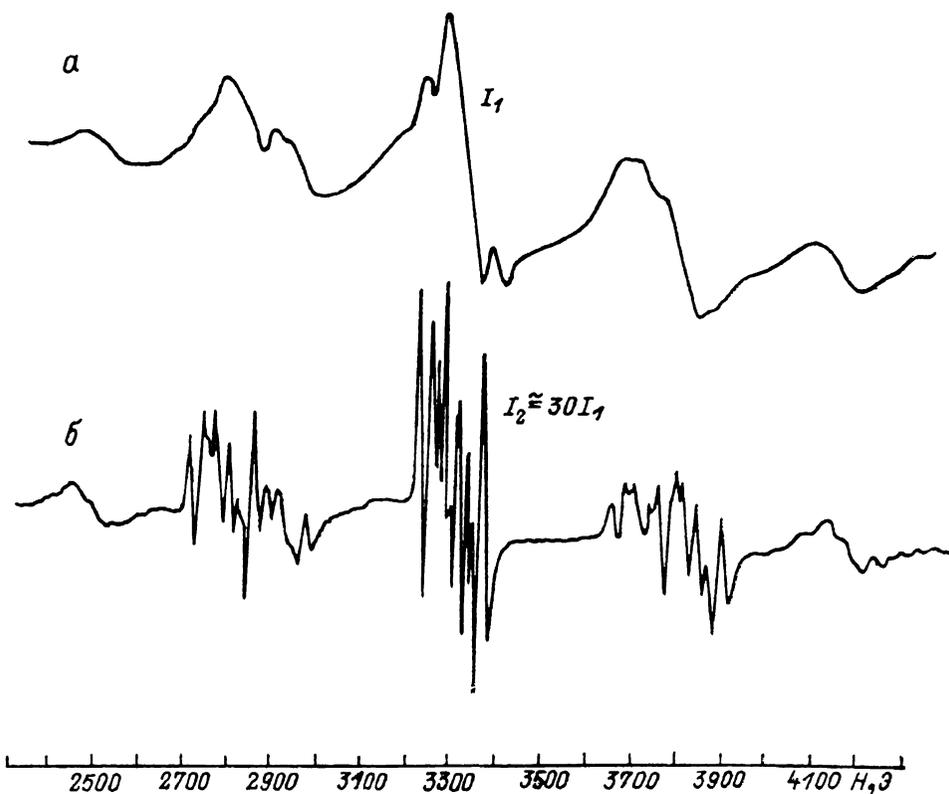


Рис. 2. Спектры ЭПР Eu^{2+} в RbTe при направлении магнитного поля вдоль оси $\langle 100 \rangle$. Образец 5 (см. таблицу): а — до облучения, б — после облучения, $t=4$ ч.

Для точечной симметрии O_h спиновый гамильтониан (СГ) для спина $7/2$ имеет вид [10]

$$\mathcal{H} = g\beta \hat{H} \cdot \hat{S} + b_4 \hat{O}_4 + b_6 \hat{O}_6 + A \cdot \mathbf{S} \cdot \mathbf{I}. \quad (1)$$

Основной терм иона $\text{Eu}^{2+} \ ^8S_{7/2}$ (электронная конфигурация $4f^7$) в кубическом поле расщепляется на два дублета (Γ_6 и Γ_7) и квартет (Γ_8). Для некоторых случаев, например $\mathbf{H} \parallel \langle 100 \rangle$, уровни энергии СГ (1) получены в аналитическом виде [11]. Наблюдаемый спектр ЭПР достаточно хорошо описывается случаем сильного магнитного поля.

Исследование температурной зависимости интенсивностей линий ЭПР дало возможность установить порядок расположения уровней и определить знаки констант СГ.

Детальный анализ полученных экспериментальных результатов позволил отождествить все линии в спектре и разделить линии СТС, принадлежащие ^{151}Eu и ^{153}Eu .

На рис. 4 приведен спектр центральной группы линий, принадлежащей переходу $+1/2 \leftrightarrow -1/2$, с указанием линий СТС ^{151}Eu и ^{153}Eu . По спектру ЭПР при направлении магнитного поля вдоль $[100]$ были определены константы спинного гамильтониана (1): $g=1.9975 \pm 0.0005$, $b_4=43 \pm 0.5$ Э, $b_6=-0.68 \pm 0.5$ Э,

$A=28\pm 0.5$ Э (^{151}Eu), $A=12.7\pm 0.5$ Э (^{153}Eu). Отношение СТС констант $A(^{151}\text{Eu})/A(^{153}\text{Eu})$, полученных из данных экспериментов, равно отношению магнитных моментов ядер этих изотопов.

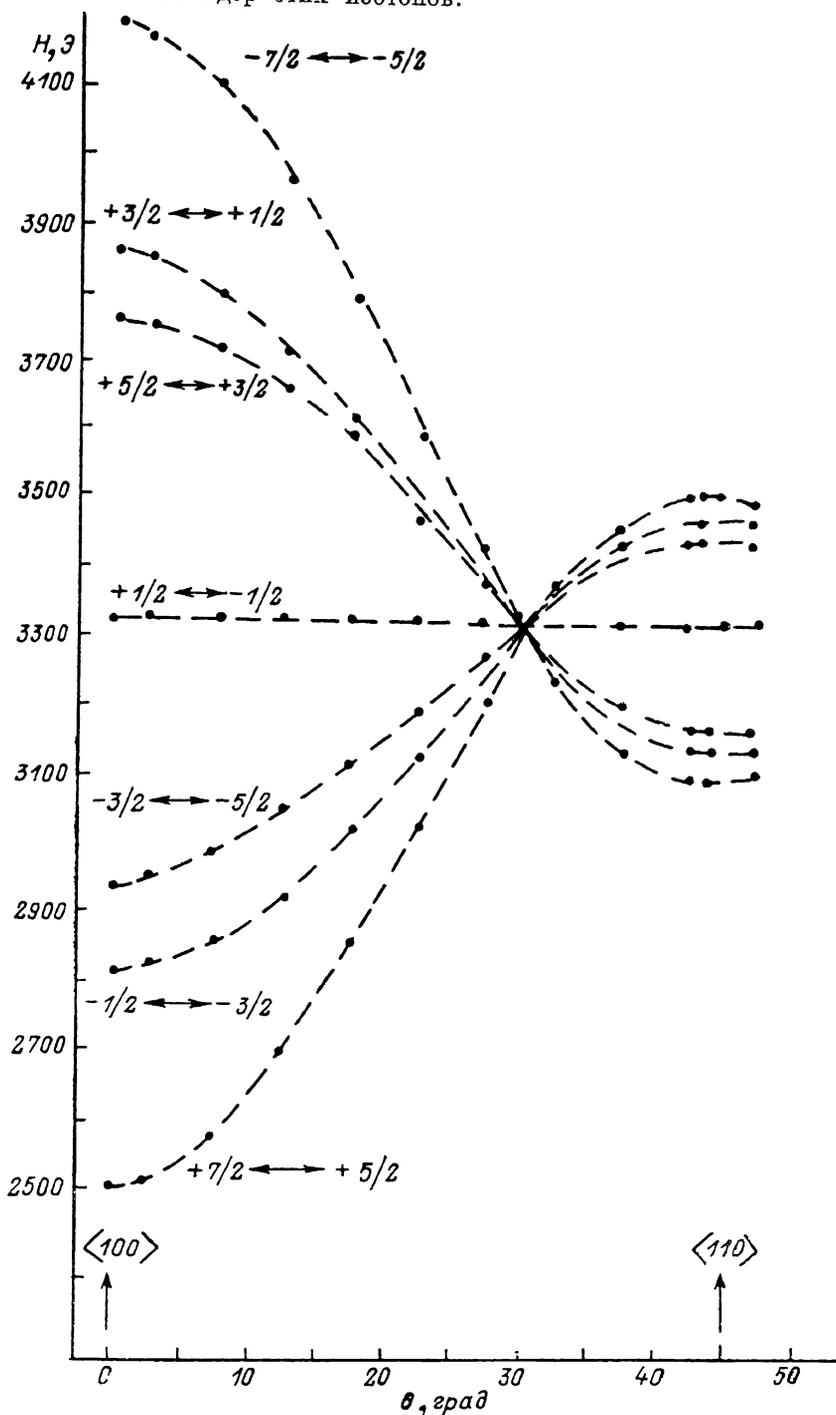


Рис. 3. Угловая зависимость тонкой структуры ЭПР Eu^{2+} в RbTe в образце 5.

Направление магнитного поля изменяется от $\langle 001 \rangle \rightarrow \langle 011 \rangle \rightarrow \langle 010 \rangle$ в плоскости (100) .

Величина g -фактора находится в пределах значений, характерных для Eu^{2+} и Gd^{2+} во многих кристаллах — щелочно-земельных, флюоритах, оксидах, хлоридах, SrTiO_3 и др.

Результаты измерений констант СТС иона Eu^{2+} в различных матрицах указывают на зависимость A от степени ковалентности связи Eu^{2+} с лигандами [12]. Наблюдается плавное уменьшение константы A с ростом ковалентности. Аналитическая зависимость известна для иона Mn^{2+} [13], но для Eu^{2+} изменение A меньше, так как внутренняя оболочка $4f^7$ экранирована внешними.

Полученное значение A для ^{151}Eu находится в согласии с величиной ковалентности. Расчет константы A аналогично [12] дает значение параметра ковалентности $\cong 20\%$, что соответствует величине $A \cong 30$ Э. Полученные данные о степени ионности RbTe согласуются с данными расчетов распределения электронной плотности в RbTe [14].

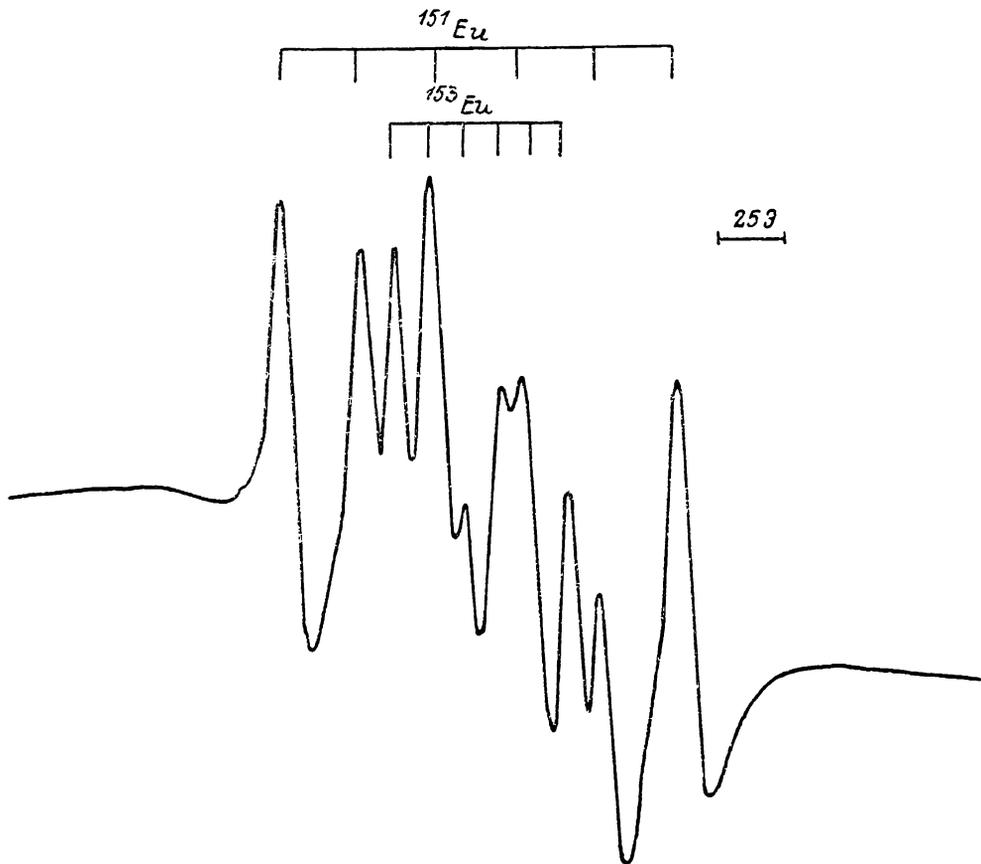


Рис. 4. Центральный переход $+1/2 \leftrightarrow -1/2$ спектра ЭПР Eu^{2+} в RbTe .

2.2. $\text{RbTe} : \text{Mn}$. В исходных монокристаллах $\text{RbTe} : \text{Mn}$ с содержанием примеси $N_{\text{Mn}} \geq 0.17$ вес % наблюдается одна широкая линия ЭПР. После облучения происходит сужение линии с $g=1.991$, ее интенсивность возрастает в 5—30 раз, и на фоне широкой линии возникает сверхтонкая структура Mn^{2+} с постоянной $A=65.6$ Э, обусловленная ЭПР уединенных ионов Mn^{2+} и совпадающая с постоянной сверхтонкой структуры в необлученных кристаллах $\text{RbTe} : \text{Mn}$ с малым содержанием примеси, в которых парамагнитные ионы не взаимодействуют между собой. Наблюдаемые изменения возможны лишь за счет увеличения числа ЭПР активных центров вследствие диффузии ионов Mn из нейтральных ассоциатов примеси под действием лазерного излучения.

Заключение. Проведенные комплексные исследования электрических, оптических свойств и ЭПР кристаллов RbTe , легированных Eu и Mn , дали возможность сделать заключение о том, что примеси Eu и Mn внедряются в решетку в двухвалентном состоянии. Наряду с этим в кристаллах существуют скопления этих примесей, в результате влияния которых происходят уширение линий

ЭПР и замывание СТС, возникновение потенциальных барьеров, проявляющихся в особенностях проводимости и фотоэде при низких температурах.

Облучение образцов ИК лазерным излучением приводит к разрушению примесных комплексов, снижению величины потенциальных барьеров, диффузии примеси в узлы решетки, о чем свидетельствуют возрастание интенсивности СТС линий ЭПР одиночных примесных узельных центров и понижение концентрации дырок в кристаллах РbТе.

В заключение авторы выражают благодарность С. А. Белоконю за предоставление монокристаллов РbТе : Eu (Mn) для исследований.

Список литературы

- [1] Кайданов В. И., Равцх Ю. И. // УФН. 1985. Т. 45. В. 1. С. 51—86.
- [2] Mills K. C. Thermodynamics data for inorganic sulphides, selenides and tellurides. London, 1974.
- [3] Белоконь С. А., Дарчук С. Д., Пляцко С. В., Сизов Ф. Ф., Тетеркин В. В. // Изв. АН СССР. Неорг. матер. 1988. Т. 24. В. 8. С. 1618—1622.
- [4] Breshi R., Camanczi A., Fano V. // J. Cryst. Growth. 1982. V. 58. N 2. P. 399—408.
- [5] Сизов Ф. Ф., Пляцко С. В., Дарчук С. Д., Тетеркин В. В., Громовой Ю. С. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 12. С. 2228—2230.
- [6] Lettenmayr H., Jantsch W., Palmetschofer L. // Sol. St. Commun. 1987. V. 64. N 6. P. 1253—1255.
- [7] Андрианов Д. Г., Белоконь С. А., Бурдакин А. А., Лакеевков В. М., Якубеня С. М. // ФТП. 1985. Т. 19. В. 7. С. 1257—1262.
- [8] Sizov F. F., Plyantsko S. V., Darchuck S. D. // Infr. Phys. 1987. V. 27. N 4. P. 249—252.
- [9] Goltos W. C., Nurmikko A. V., Partin D. L. // Sol. St. Commun. 1986. V. 59. N 2. P. 183—186.
- [10] Title R. S. // Phys. Rev. 1964. V. 133. N 1. P. A198—A202.
- [11] Абрагам А., Блини Б. ЭПР переходных ионов. М., 1972.
- [12] Nicula L., Pana O., Jiurguy L. V. // Phys. Lett. (a). 1986. V. 119. N 1. P. 92—103.
- [13] Simanek E., Müller K. A. // J. Phys. Chem. Sol. 1970. V. 31. N 8. P. 1027—1040.
- [14] Schluter M., Martinez G., Cohen M. L. // Phys. Rev. B. 1975. V. 11. N 6. P. 3808—3813.

Институт полупроводников АН УССР
Киев

Получена 14.09.1988
Принята к печати 8.02.1989